DIN 50450-9:2021-07 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Verunreinigungen in Träger- und Dotiergasen - Teil 9: Bestimmung von Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffmonooxid, Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und C<(Index)1>-C<(Index)3>-Kohlenwasserstoffen in Chlorwasserstoff mit Gaschromatographie

| inna | ait | Seite |
|--|--|----------|
| Vorw | ort | 3 |
| 1 | Anwendungsbereich | 4 |
| 2 | Normative Verweisungen | 4 |
| 3 | Begriffe | 4 |
| 4 | Kurzbeschreibung | 4 |
| 5 | Prüfeinrichtung | 5 |
| 6 | Kalibrier- und Betriebsgase | 6 |
| 7 | Vorbereitung | <i>6</i> |
| 7.1 | Probenvorbereitung | 6 |
| 7.2 | Prüfung der Messanordnung | |
| 8 | Durchführung | |
| 8.1 8.2 | Bestimmung der RückspülzeitKalibrierung | |
| 8.3 | Spülung | |
| 8.4 | Messung | |
| 8.5 | Wiederholung der Kalibrierung | |
| 9 | Angabe der Ergebnisse | 7 |
| 10 | Prüfbericht | 7 |
| Anha | ng A (informativ) Beispiel für die Reinheitsspezifikation von Chlorwasserstoff | 8 |
| | | |
| Bilde | r | |
| Bild 1 | 1 — Gasfluss bei Dosierung | 5 |
| Bild 2 | 2 — Gasfluss bei Rückspülung | 5 |
| - | | |
| | | |
| Tabel | llen | |
| Tabelle A.1 — Beisniel für die Reinheitssnezifikation von Chlorwasserstoff | | |